

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
30. September 2004 (30.09.2004)

PCT

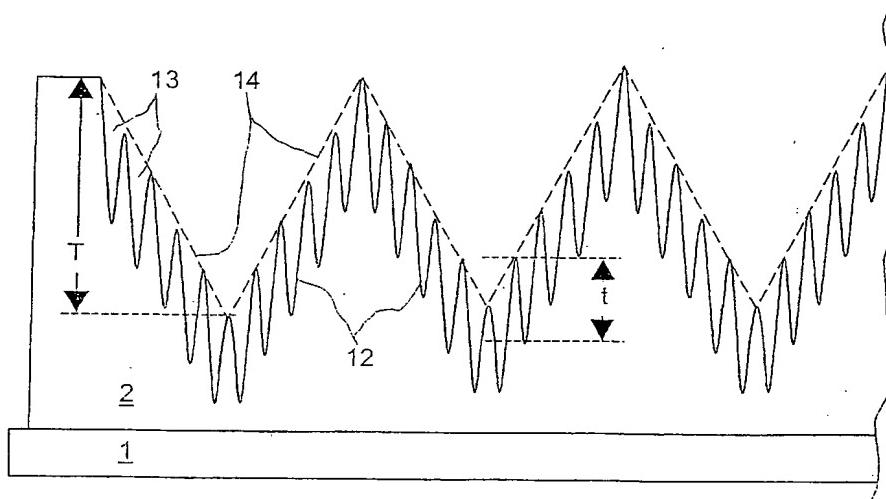
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/083911 A1**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G02B 5/18, B42D 15/10, G06K 19/16
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/002822
- (22) Internationales Anmeldedatum:  
18. März 2004 (18.03.2004)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:  
103 12 564.7 21. März 2003 (21.03.2003) DE  
103 18 105.9 22. April 2003 (22.04.2003) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): OVD KINEGRAM AG [CH/CH]; Zählerweg 12, CH-6301 Zug (CH).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHILLING, Andreas [DE/CH]; Flurstrasse 20, CH-6332 Hagedorn (CH). TOMPKIN, Wayne, Robert [US/CH]; Oesterliwaldweg 2, CH-5400 Baden (CH).
- (74) Anwalt: ZINSINGER, Norbert; Louis Pöhlau Lohrentz, Postfach 30 55, 90014 Nürnberg (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MICROSTRUCTURE AND METHOD FOR PRODUCING MICROSTRUCTURES

(54) Bezeichnung: MIKROSTRUKTUR UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MIKROSTRUKTUREN



(57) Abstract: The invention relates to light-diffracting microstructures that are produced by superimposing at least two relief structures of which the first relief structure is mechanically produced, and at least one second relief structure is a photomechanically generated diffraction structure. The invention also relates to a method for producing light-diffracting microstructures, which are additive superimpositions comprised of a relief structure and of at least one diffraction structure. This method is characterized by the following steps: a) production of a layer (2) made of a photoresist on a substrate (1) whose free surface comprises the relief structure; b) producing an interference pattern with coherent light via the relief structure (5); c) aligning the relief structure with the interference pattern; d) exposing the relief structure by means of the interference pattern; e) developing the photoresist during which the exposure causes the removal of altered material of the photoresist, and recesses, e.g. grooves, of the diffraction structure form on the relief structure, and; f) drying the photoresist.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

**WO 2004/083911 A1**